キャスト成長多結晶シリコン中の酸素析出物分布と粒界との関係

Relationship between Oxygen Precipitate Distribution and Grain Boundaries in Cast-Grown Multicrystalline Silicon 明治大学¹, 神奈川県産業技術センター² ⁰宇野 匠^{1,2}, 佐藤 邦孝^{1,2}, 小椋 厚志¹, 小野 春彦^{1,2} Meiji Univ.¹, Kanagawa Ind. Tech. Center² [°]Takumi Uno^{1, 2}, Kuniyuki Sato^{1, 2}, Atsushi Ogura¹, and Haruhiko Ono^{1, 2} Email: ce41015@meiji.ac.jp

[はじめに] 結晶シリコン太陽電池の変換効 率を更に向上させるためには、酸素析出物 や結晶粒界を制御することが必須である。 一般に、析出物はフーリエ変換赤外分光法 (FTIR) で、結晶粒界は電子線後方散乱回折 法 (EBSD) で評価されることが多い。しか しながら、FTIRは試料の内部を評価するの に対し、EBSDは試料表面を観測するため、 析出物と結晶粒界の位置関係を比較するこ とは困難であった[1]。そこで本研究では、 これらの位置関係を調べるために、試料の

表裏両面の粒界分布を測定し、酸素析出物 分布との比較を行った。

[実験方法] キャスト法で作製された直径 100 mmのp型Siインゴットを縦切りにし、両 面鏡面研磨を施して、厚さ0.40 mmの試料を 準備した。顕微赤外分光装置を用いて分解 能4 cm⁻¹、アパーチャ径40 µm、測定間隔40 µmで測定を行った。得られたスペクトルか ら酸素析出物 (アモルファスSiO₂)の積分 強度分布を作成した。また、EBSD (加速電 圧20 kV)を用いて、対応粒界の種類毎の分 布を表裏両面で測定した。

[結果]FTIRで得られた酸素析出物の分布 Fig.1を示す。赤色の領域はピーク強度が強 く、多くの酸素が析出していることを表し ている。Fig.2とFig.3は、Fig.1と同じ領域に おけるランダム粒界とΣ3粒界の分布をそれ ぞれ示している。赤線が表面側、黒線が裏 面側の各粒界を重ねて表している。Fig.1と Fig.2、3とを比較すると、Σ3粒界の分布は酸 素析出物の分布と必ずしも一致していない のに対し、ランダム粒界の分布は酸素析出 物の分布と非常によく似ていることがわか る。このことは、ランダム粒界が析出物生 成に関係していることを示しており、ラン ダム粒界が酸素析出物の核となっている可 能性が示唆される。

[謝辞]本研究の一部はNEDOの助成を受けて実施された。

[1]小野他,2010年第57回春季応物,18p-TG-2



Fig.1 Distribution of oxygen precipitates.







Fig.3 Distribution of Σ 3 boundaries.